

| | |
|--------------------|---|
| 公開番号 又は 特許番号 | 特許 5565788 |
| 発明名称 | 電鍍モールドパターンの作製方法 |
| 出願人 又は 権利者 | 独立行政法人産業技術総合研究所 |
| 想定デバイス | シート型健康管理デバイス |
| 要約 | <p>【利用分野】</p> <p>MEMS 等加工技術において、側壁に勾配を形成するのが困難なマイクロ・ナノパターンに対して、レジストパターンの側壁に任意の角度で傾斜面を付与できる紫外線露光方法、紫外線露光装置に関するもの。</p> <p>【発明の内容】</p> <p>紫外線の集点と基板上に形成された紫外線感光性材料の相対位置を変化させて紫外線感光性材料をフォトマスクのパターンに露光するステップと紫外線感光性材料を現像するステップとを含み、側壁に上記相対位置に応じた傾斜面を有する紫外線感光性材料のパターンを形成することを特徴とする紫外線露光方法及び紫外線露光装置。</p> |
| 図面 | <p>The figure illustrates the process of forming a pattern with a slanted sidewall using UV exposure. It shows a lens (レンズ) and a substrate (基板) with a resist (レジスト) layer. The lens is positioned above the resist, and UV light (紫外線) is directed through it. The diagram shows five stages (a) through (e) of the process, where the lens and substrate are moved relative to each other to create different sidewall angles. The resist is labeled as positive resist (ポジ型レジスト). The substrate is labeled as 基板. The UV light is labeled as 紫外線. The lens is labeled as レンズ.</p> |